

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成24年5月17日(2012.5.17)

【公表番号】特表2012-501770(P2012-501770A)

【公表日】平成24年1月26日(2012.1.26)

【年通号数】公開・登録公報2012-004

【出願番号】特願2011-526427(P2011-526427)

【国際特許分類】

A 6 2 C 3/00 (2006.01)

【F I】

A 6 2 C 3/00 J

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月21日(2012.3.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

化学的なプロセスを実施するためのプラントのためのインフラストラクチャであって、
a) 物質及び / 又はエネルギー及び / 又は情報を、出発材料を収容及び / 又は準備するための装置、生成物を収容及び / 又は準備するための装置、出発材料を反応させて生成物にする反応を開ループ制御及び / 又は閉ループ制御するための装置相互間及び / 又は出発材料を反応させて生成物にするための少なくとも 1 つの反応器と前記装置との間で交換可能とする組み込まれた線路と、

b) 前記装置及び / 又は前記反応器が固定可能な少なくとも 1 つの取り付け域と、を備える、化学的なプロセスを実施するためのプラントのためのインフラストラクチャにおいて、

c) 前記インフラストラクチャが可搬であり、

d) 前記インフラストラクチャが少なくとも 1 つの立ち入り可能な室を空間的に画成し、

e) 前記取り付け域が前記室内に配置されており、

f) 前記インフラストラクチャが消火剤分配手段を備える

ことを特徴とする、化学的なプロセスを実施するためのプラントのためのインフラストラクチャ。

【請求項 2】

前記消火剤分配手段が、前記室内での消火剤の分配を許可する、請求項 1 記載のインフラストラクチャ。

【請求項 3】

前記消火剤分配手段が、前記インフラストラクチャを取り巻く環状線路を備え、該環状線路が、前記プラントの液体噴霧のための、互いに間隔を置いて配置された多数のノズルを備える、請求項 1 又は 2 記載のインフラストラクチャ。

【請求項 4】

前記インフラストラクチャが、消火剤を前記消火剤分配手段に供給するための、外部から接近可能な少なくとも 1 つの消火剤接続部を備える、請求項 1 から 3 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 5】

前記室が強制通気を備える、請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項記載のインフラストラ

クチャ。

【請求項 6】

前記室が気密に遮断可能である、請求項 1 から 5 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 7】

前記室が捕集槽により受けられている、請求項 1 から 6 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 8】

前記取り付け域が、前記装置及び / 又は前記反応器及び / 又は補助ユニットを受容するための多数の受容部を備える、請求項 1 から 7 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 9】

前記受容部の少なくとも一部が、それぞれ、正六角形の形態を有しており、これらの六角形の受容部の壁と壁とがハニカム状に互いに隣接している、請求項 8 記載のインフラストラクチャ。

【請求項 10】

前記インフラストラクチャが前記室内に 2 つの取り付け域を備え、該取り付け域が互いに直交するように延在している、請求項 1 から 9 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 11】

前記インフラストラクチャが、エネルギー及び / 又は補助媒体及び / 又は副生成物を供給又は導出するための、外部に面した少なくとも 1 つのインターフェースを有する、請求項 1 から 10 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 12】

前記インフラストラクチャが、規格コンテナ、特に ISO 668 規格のコンテナの大きさを有する、請求項 1 から 11 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャ。

【請求項 13】

化学的なプロセスを実施するためのプラントにおいて、

a) 出発材料を収容及び / 又は準備するための少なくとも 1 つの装置と、
b) 生成物を収容及び / 又は準備するための少なくとも 1 つの装置と、
c) 出発材料を反応させて生成物にするための少なくとも 1 つの反応器と、
d) 前記反応を開ループ制御及び / 又は閉ループ制御するための少なくとも 1 つの装置とを備え、請求項 1 から 12 までのいずれか 1 項記載のインフラストラクチャをベースに形成されていることを特徴とする、化学的なプロセスを実施するためのプラント。

【請求項 14】

請求項 13 記載のプラントを用いて生成物を製造する方法において、

以下のステップ、すなわち：

a) 反応を開ループ制御又は閉ループ制御するための装置内で、前記反応器内での反応の開ループ制御又は閉ループ制御のために必要な情報を記録しながら、第 1 の時間にわたって第 1 の量の生成物を製造するステップと、
b) 前記インフラストラクチャ及び前記反応を開ループ制御又は閉ループ制御するための装置を維持したまま、プラントの容量を拡大するステップと、
c) 前記反応を開ループ制御又は閉ループ制御するための装置から、前記反応器内での反応の開ループ制御又は閉ループ制御のために必要な情報を読み出しながら、第 2 の時間にわたって第 2 の量の生成物を製造するステップとを備え、

前記第 2 の量が前記第 1 の量より大きく、かつ前記第 2 の時間が前記第 1 の時間の後に位置することを特徴とする、生成物を製造する方法。